

Изобретение относится к технологии полупроводниковой микро- и наноэлектроники, в частности к золь-гель технологии получения непрерывных пленок оксида цинка и может быть использовано в производстве оптоэлектронных устройств.

Золь-гель метод получения непрерывных микроцилиндрических пленок оксида цинка в стеклянной оболочке включает изготовление раствора для образования пленок оксида цинка - золь, осаждение тонкого слоя золя на внутренней поверхности одного или нескольких стеклянных микрокапилляров путем центрифугирования, сушку микроцилиндрических пленок в вакууме при $300...350^{\circ}\text{C}$, повторение процедуры осаждения и сушки несколько раз, термообработку на воздухе при $450...550^{\circ}\text{C}$ в течение 1 часа с последующей термообработкой при $500...550^{\circ}\text{C}$ под вакуумом при давлении $1\cdot 10^{-3}$ мм рт. ст. в течении 1...4 часов, после чего вакуумированные микрокапилляры с полученными микроцилиндрическими пленками охлаждают, а их концы герметизируют *in situ* при температуре отверждения и сушки уплотнительного материала.

П. формулы: 1

Фиг.: 1